

	English	中文	交通アクセス・地図	お問い合わせ	サイトマップ	サイト内検索
	受験生の方	広大へ留学希望の方	一般・地域の方	企業の方	卒業生の方	在学生・保護者の方

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

[広大公式アカウント一覧](#)
 Twitter

 Facebook  
(日本語版)

 Facebook  
(英語版)

 YouTube

 行事カレンダー

 ストリートビュー

 キャンパスカメラ

 学内ポータル

[トップページ](#) > [広報・報道](#) > [報道発表・報道された広島大学](#) > [平成18年1月-12月](#) > 次世代の超高速半導体集積回路に対応する新しい信号伝送・配線技術を開発

次世代の超高速半導体集積回路に対応する新しい信号伝送・配線技術を開発

報道機関各位

平成18年6月9日  
国立大学法人広島大学  
広報グループ広報課長

## 記者発表会のご案内

次世代の超高速半導体集積回路に対応する新しい信号伝送・配線技術を開発

広島大学の吉川公麿教授(ナノデバイス・システム研究センター)と佐々木守助教授(大学院先端物質科学研究科)は、次世代の超高速半導体集積回路に対応する新しい信号伝送・配線技術を開発しました。

今回開発した技術は、次世代の超高速半導体集積回路に対応する、チップ内あるいはチップ間を高速で結ぶワイヤレス配線と高速クロック発生・分配に関するもので、現在、世界的に最も注目を集めている技術です。

本技術により、将来の高速ネットワークサーバや多機能携帯端末などに高密度で集積される数多くのLSI同士の超高速信号伝送が可能となります。

広島大学では、ナノデバイス・システム研究センターが、大学院先端物質科学研究科と協力して推進している文部科学省21世紀COEプログラム「テラビット情報ナノエレクトロニクス」の主テーマとして研究をすすめており、このたびの成果は、半導体技術を革新する技術成果です。吉川教授と佐々木助教授は、本成果を、今月15日～18日にホノルルで開催される、米国電気電子学会の超LSI回路シンポジウム国際会議(IEEE Symposium on VLSI Circuits)で、それぞれ発表します。この会議では、半導体集積回路に関する世界最高レベルの学会であり、日本の大学として発表するのはきわめて難しい上、同時に同じ大学から2件の発表は極めてまれなことです。

つきましては、下記のとおり記者発表会を開催し、詳細をご説明いたします。ご多忙とは存じますが、是非ご参加いただきたくご案内申し上げます。

## 記

開催日時 平成18年6月12日(月) 13時～14時

場所 広島大学ナノデバイス・システム研究センター 会議室(東棟5F)  
(広島大学東広島キャンパス)出席者 広島大学ナノデバイス・システム研究センター 教授 吉川公麿  
広島大学大学院先端物質科学研究科 助教授 佐々木守

報道解禁日時: 米国電気電子学会の超LSI回路シンポジウム国際会議での発表日以降

吉川公麿 日本時間6月18日(日)午前4時20分  
佐々木守 日本時間6月17日(土)午前4時45分

## 【お問い合わせ先】

広島大学広報グループ  
TEL:082-424-6017  
E-mail:koho@office.hiroshima-u.ac.jp

※記者発表会へ出席予定の報道関係の方は、会社名及び氏名を、6月12日(月)10時までに、広島大学広報グループへ、電話又はメールでご連絡ください。